|  |
| --- |
| Задания СРС 2 микроэлектроника |
|  |  | ФИО студента | оценка |
| 1. Топология микросхем.
 |  |  |  |
| 1. Тонкие пленки в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Металлические тонкие пленки в микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. Диэлектрические тонкие пленки в микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. Керметные тонкие пленки в микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. полупроводниковые тонкие пленки в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Начальные стадии роста пленки.
 |  |  |  |
| 1. Роль дефектов при росте тонких пленок.
 |  |  |  |
| 1. Поверхностное сопротивление.
 |  |  |  |
| 1. Тонкопленочные резисторы в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Тонкопленочные конденсаторы в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Аморфный кремний в микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. Аморфный селен
 |  |  |  |
| 1. Тонопленочные антиотражающие покрытия
 |  |  |  |
| 1. Поликристаллические материалы в современной микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. Нанокристаллические материалы в современной микроэлектронике
 |  |  |  |
| 1. Аморфные тонкопленочные материалы в современной микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Технология тонких пленок в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Термическое вакуумное испарение.
 |  |  |  |
| 1. Электронно-лучевое испарение в вакууме.
 |  |  |  |
| 1. Молекулярно-лучевая эпитаксия.
 |  |  |  |
| 1. Многослойные пленки в микроэлектронике.
 |  |  |  |
| 1. Газовый разряд в технологии напыления пленок.
 |  |  |  |
| 1. Катодное распыление на постоянном токе.
 |  |  |  |
| 1. Магнетронное распыление на постоянном токе.
 |  |  |  |
| 1. СВЧ магнетронное распыление.
 |  |  |  |
| 1. Промышленная установка магнетронного напыления.
 |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления микросхем.
 |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления резистора.
 |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления тонкопленочного конденсатора.
 |  |  |  |
| 1. Технологический маршрут изготовления полевого транзистора.
 |  |  |  |